

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成19年12月6日(2007.12.6)

【公表番号】特表2007-510173(P2007-510173A)

【公表日】平成19年4月19日(2007.4.19)

【年通号数】公開・登録公報2007-015

【出願番号】特願2006-536846(P2006-536846)

【国際特許分類】

*G 03 F 7/42 (2006.01)*

*C 11 D 7/50 (2006.01)*

*H 01 L 21/304 (2006.01)*

【F I】

*G 03 F 7/42*

*C 11 D 7/50*

*H 01 L 21/304 6 4 7 Z*

【手続補正書】

【提出日】平成19年10月22日(2007.10.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a) 5重量百分率から50重量百分率の双極子モーメントが3.5以上の極性非プロトン性窒素含有溶媒；

(b) 0.2重量百分率から20重量百分率の、ビスコリン塩、トリスコリン塩、およびそれらの混合物から成る群から選択されたコリン誘導体；および

(c) 50重量百分率から94重量百分率の、スルホキシド、スルホン、およびそれらの混合物から成る群から選択された硫黄含有溶媒

を含む洗浄またはフォトレジスト除去のための組成物。

【請求項2】

極性非プロトン性窒素含有溶媒がN-メチル-2-ピロリドン [N-methyl-2-pyrrolidone]を含む請求項1に記載の組成物。

【請求項3】

極性非プロトン性窒素含有溶媒が15重量百分率から35重量百分率の量で存在する請求項1に記載の組成物。

【請求項4】

コリン誘導体が0.5重量百分率から10重量百分率の量で存在する請求項1に記載の組成物。

【請求項5】

硫黄含有溶媒がジメチルスルホキシド [dimethyl sulfoxide]、メチルスルホキシド [methyl sulfoxide]、あるいはそれらの混合物を含む請求項1に記載の組成物。

【請求項6】

さらに実質的に水分が含まれていない請求項1に記載の組成物。

【請求項7】

水が、最高で10重量百分率の量で含まれている請求項1に記載の組成物。

【請求項8】

(a) 1重量百分率から70重量百分率のビス-(2-ヒドロキシ-エチル)-ジメチル-アンモニウムの水酸化物または塩、トリス-(2-ヒドロキシ-エチル)-メチル-アンモニウムの水酸化物または塩、あるいはそれらの混合物、

(b) 水；および

(c) 0.2重量百分率から20重量百分率のアミン

を含む洗浄またはフォトレジスト除去のための組成物であって、極性有機溶媒及びヒドロキシリアルアミンが含まれていない組成物。

【請求項9】

請求項1～8のいずれか記載の組成物に基板を1～60分間、温度10～100にて接触させることを含む、集積回路からフォトレジスト、エッチング残渣およびフラックス材の一種以上を除去するための方法。